A photosensitive layer composed of positive photoresist (2) is formed on a processed substrate (1) with the section generating energy to put out the liq. (a). After (2) is patterned by required exposure and processing more than twice, a material to form the liq. course is coated on the resist patterns and is hardened. The liq. course is formed by melting and removing the patterned positive photoresist. The liq.-spraying recording head is produced. The liq. course is composed of active energy hardening or heat hardening material.

Week

(a) is electro-thermal converter. The liq. spraying recording head is full-line type with series of openings throughout the recorded area. The openings for multicolours are integrally formed. The developer of (2) is an alkali soln. (2) contains naphthoquinonediazide deriv. and is chemical amplifying type.

In the fig. (3) = mask, (7) = first resist pattern, (8) = secondresist pattern.

ADVANTAGE - The liq. spraying recording has nozzle with high accuracy and reliability.

Dwq.1/3

Abstract (Equivalent): US 5524784 A

A method for producing an ink jet head with an ink passage communicated to an ink discharge opening, the method comprising the steps of: exposing a photosensitive resin on a substrate according to the pattern of the ink passage; developing the resin according to the pattern of the ink passage to partially remove the photosensitive resin after exposure; thereafter further exposing the resin according to the pattern of the ink passage; thereafter further developing the resin according to the pattern of the ink passage to remove the further exposed photosensitive resin; filling a gap in the pattern with material for forming a wall of the ink passage; and removing the rest of the resin to form the ink passage.

Dwq.0/9 Title Terms: PRODUCE; LIQUID; SPRAY; RECORD; HEAD; HIGH; RELIABILITY; FORMING; POSITIVE; PHOTORESIST; PROCESS; SUBSTRATE; PATTERN; SUBSTRATE; REQUIRE; EXPOSE; FORMING; LIQUID; COURSE; REST; PATTERN Derwent Class: E14; G06; L03; P74; P75; P84; T04 International Patent Class (Main): B41C-001/00; B41J-002/05 International Patent Class (Additional): B41J-002/16; B41J-002/21; G03F-007/00 File Segment: CPI; EPI; EngPI Manual Codes (CPI/A-N): E10-A09B1; G05-F03; G06-D04; G06-G; G06-G18; L03-D04G Manual Codes (EPI/S-X): T04-G02A Chemical Fragment Codes (M3):

01 G020 G022 G023 G221 H4 H401 H441 H8 K0 K432 K5 K533 L7 L722 M280

M320 M414 M510 M520 M531 M540 M781 M903 M904 Q344 Q349 Q454 9407-C0401-U

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出顧公開番号

特開平6-8437

(43)公開日 平成6年(1994)1月18日

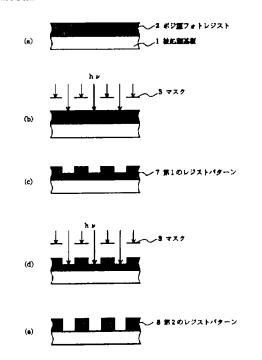
2/16					
		9012-2C	B 4 1 J	3/04 1 0 3 B	
		8306-2C	審査請求 未請求	101 A	
				: 請求項の数12(全 7 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特顧平4-1 66400	_	(71)出願人	000001007	
				キヤノン株式会社	
(22)出願日	平成4年(1992)6月24日			東京都大田区下丸子3丁目3	0番2号
			(72)発明者	芝 昭二	
				東京都大田区下丸子3丁目3	0番2号 キヤ
				ノン株式会社内	
			(72)発明者	今村 功	
				東京都大田区下丸子3丁目3	0番2号 キヤ
				ノン株式会社内	
			(74)代理人	弁理士 若林 忠	

(54) 【発明の名称】 液体噴射記録ヘッド、その製造方法及び記録装置

(57)【要約】

【構成】 被処理基板1上にポジ型フォトレジスト層2 を形成後、マスク3を介して露光し、現像してレジスト のパターニングを行なう際に、露光、現像処理を2度以 上施してパターン形成を行なう。

【効果】 信頼性の高いノズルを有する液体噴射記録へ ッドを製造することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液体吐出エネルギー発生部を有する被処 理基板上にポジ型フォトレジストからなる感光層を形成 し、所要の露光、現像処理を行ってポジ型フォトレジス トをパターニングした後、レジストパターン上に液流路 形成用材料を被覆し、液流路形成用材料を硬化させた 後、パターニング処理されたポジ型フォトレジストを溶 解除去することによって液流路が形成された構造を有す る液体噴射記録ヘッドにおいて、ポジ型フォトレジスト のパターニング時に、露光、現像処理を二度以上施して 10 上記工程を行うことを特徴とする液体噴射記録ヘッド。

【請求項2】 液流路形成用材料が活性エネルギー線硬 化型材料であることを特徴とする請求項1に記載の液体 噴射記録ヘッド。

【請求項3】 液流路形成用材料が熱硬化型材料である ことを特徴とする請求項1に記載の液体噴射記録へッ

【請求項4】 液体吐出エネルギー発生部が、熱エネル ギーを発生する電気熱変換体であることを特徴とする請 求項1に記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項5】 記録媒体の記録領域の全幅にわたって吐 出口が複数設けられているフルラインタイプのものであ ることを特徴とする請求項1に記載の液体噴射記録ヘッ

【請求項6】 多色用の吐出口が一体成形されたもので あることを特徴とする請求項1に記載の液体噴射記録へ ッド。

【請求項7】 液体吐出エネルギー発生部を有する被処 理基板上にポジ型フォトレジストからなる感光層を形成 し、所要の露光、現像処理を行ってポジ型フォトレジス 30 程(e))。更に、上記パターニングされた固体層を、 トをパターニングした後、レジストパターン上に液流路 形成用材料を被覆し、液流路形成用材料を硬化させた 後、パターニング処理されたポジ型フォトレジストを溶 解除去することによって液流路を形成する液体噴射記録 ヘッドの製造方法において、ポジ型フォトレジストのパ ターニング時に、露光、現像処理を二度以上施して上記 工程を行うことを特徴とする液体噴射記録ヘッドの製造 方法。

【請求項8】 ポジ型フォトレジストの現像液としてア の製造方法。

【請求項9】 ポジ型フォトレジストがナフトキノンジ アジド誘導体を含有するものであることを特徴とする請 求項7に記載の製造方法。

【請求項10】 ポジ型フォトレジストが化学増幅型の ものであることを特徴とする請求項7に記載の製造方 法。

【請求項11】 記録媒体の被記録面に対向してインク を吐出するインク吐出口が設けられている請求項1に記 載の液体噴射記録ヘッドと、該ヘッドを載置するための 50 【0006】

2 部材とを少なくとも具備することを特徴とするインクジ エット記録装置。

【請求項12】 請求項11に記載のインクジェット記 録装置において、カラー記録を行うことを特徴とするイ ンクジェット記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はインクジェット記録方式 に用いる記録液小滴を発生させるための液体噴射記録へ ッド、その製造方法及び該記録ヘッドを用いた記録装置 に関する。

[0002]

【従来の技術】インクジェット記録方式(液体噴射記録 方式)に適用される液体噴射記録ヘッドは、一般に微細 な記録液吐出口(オリフィス)、液体流路及び液体流路 の一部に設けられる液体吐出エネルギー発生部を備えて いる。従来このような液体噴射記録ヘッドを作製する方 法としては、例えば、特開昭61-154947号公 報、同62-253457号公報に記載された次のよう 20 な工程による方法が知られている。

【0003】図2に示すように、先ず、被処理基板1上 に感光性樹脂層(ポジ型フォトレジスト2)を形成し (工程(a))、これをマスク3を介して露光(工程 (h))、現像処理を施して感光性樹脂層をパターニン グし、被処理基板上に固体層を形成する(工程 (c))。次に、パターニングされた固体層上に活性エ ネルギー線硬化型あるいは熱硬化型の液流路形成用材料 5 を被覆し(T.程(d))、活性エネルギー線照射ある いは加熱により上記液流路形成用材料を硬化させる(エ 含ハロゲン炭化水素、ケトン、エステル、エーテル、ア ルコール等の有機溶剤あるいは水酸化ナトリウム、水酸 化カリウム等のアルカリ水溶液を用いて溶解除去し、液 流路6を形成する(工程(f))。

【0004】上記の工程において、周体層を形成するた めの感光性樹脂材料としては、一般にナフトキノンジア ジド誘導体を含有するポジ型フォトレジストが用いられ ている。ここで用いられるポジ型フォトレジスト中に含 まれるナフトキノンジアジド誘導体は、レジストのパタ ルカリ水溶液を用いることを特徴とする請求項7に記載 40 ーニングの際に用いられる i 線やg線といった露光波長 に対して強い吸収を有している。このため、レジストを 厚膜で使用する場合には、照射された光がレジスト膜中 で減衰し、レジストの下層部において露光量が不足し十 分なパターニングが不可能となる。

> 【0005】現在、厚膜用として市販されているレジス トを用いた場合においても、寸法精度良くパターニング できる膜厚はせいぜい 2 0 μ m程度であり、それ以上の 膜厚においては上部が極端な台形のレジストパターンし か得られていない。

【発明が解決しようとする課題】本願発明における目的 は、除去可能な固体層としてポジ型フォトレジストを用 いた場合に、寸法精度良くパターニングされたレジスト パターンを形成し、信頼性の高い液体噴射記録ヘッドを 提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記課題を 解決するために鋭意検討した結果、本発明に到達したも のである.

【0008】本願発明は、液体吐出エネルギー発生部を 10 有する被処理基板上にポジ型フォトレジストからなる感 光層を形成し、所要の露光、現像処理を行ってポジ型フ ォトレジストをパターニングした後、レジストパターン 上に液流路形成用材料を被覆し、液流路形成用材料を硬 化させた後、パターニング処理されたポジ型フォトレジ ストを溶解除去することによって液流路が形成された構 造を有する液体噴射記録ヘッドにおいて、ポジ型フォト レジストのパターニング時に、露光、現像処理を二度以 上施して上記工程を行うことを特徴とする液体噴射記録 ヘッドの製造方法であり、該方法により提供される液体 20 噴射記録ヘッドである。

【0009】このように、ポジ型フォトレジストのパタ ーニングに際して、レジストのパターニング時の露光、 現像処理を2度以上に分けて行うことによって、厚膜に おいても寸法精度の優れた整った矩形のレジストパター ンを形成することができ、吐出特性の優れた信頼性の高 い液体噴射記録ヘッドを提供できる。また、上記方法に おいては、ナフトキノン系のポジ型フォトレジストを用 いた場合の液体噴射記録ヘッドの製造方法を示している が、これは化学増幅型のポジ型フォトレジストを用いた 30 場合においても適用可能である。

【0010】本発明は、特にインクジェット記録方式の 中でも、熱エネルギーを利用してインクを吐出させる方 式の記録ヘッド、記録装置において、優れた効果をもた らすものである。

【0011】その代表的な構成や原理については、例え は、米国特許第4,723,129号明細書、同第4, 740、796号明細書に開示されている基本的な原理 を用いて行なうものが好ましい。この方式はいわゆるオ 能であるが、特に、オンデマンド型の場合には、液体 (インク) が保持されているシートや液路に対応して配 置されている電気熱変換体に、記録情報に対応していて 核沸騰を越える急速な温度上昇を与える少なくとも一つ の駆動信号を印加することによって、電気熱変換体に熱 エネルギーを発生せしめ、記録ヘッドの熱作用面に膜沸 騰させて、結果的にこの駆動信号に一対一対応し液体 (インク) 内の気泡を形成出来るので有効である。この 気泡の成長、収縮により吐出用開口を介して液体(イン ク)を吐出させて、少なくとも一つの滴を形成する。こ 50 【0017】以上の説明においては、インクを液体とし

の駆動信号をパルス形状とすると、即時適切に気泡の成 長収縮が行なわれるので、特に応答性に優れた液体(イ ンク) の吐出が達成でき、より好ましい。このパルス形 状の駆動信号としては、米国特許第4,463,359 号明細書、同第4、345,262号明細書に記載され ているようなものが適している。なお、上記熱作用面の 温度上昇率に関する発明の米国特許第4, 313, 12 4号明細書に記載されている条件を採用すると、さらに 優れた記録を行なうことができる。

【0012】記録ヘッドの構成としては、上述の各明細 書に開示されているような吐出口、液路、電気熱変換体 の組み合わせ構成(直線状液流路または直角液流路)の 他に熱作用部が屈曲する領域に配置されている構成を開 示する米国特許第4,558,333号明細書、米国特 許第4, 459, 600号明細書を用いた構成も本発明 に含まれるものである。加えて、複数の電気熱変換体に 対して、共通するスリットを電気熱変換体の吐出部とす る構成を開示する特開昭59-123670号公報や熱 エネルギーの圧力波を吸収する関口を吐出部に対応させ る構成を開示する特開昭59-138461号公報に基 づいた構成としても本発明は有効である。

【0013】さらに、記録装置が記録できる最大記録媒 体の幅に対応した長さを有するフルラインタイプの記録 ヘッドとしては、上述した明細書に開示されているよう な複数記録ヘッドの組み合わせによって、その長さを満 たす構成や一体的に形成された一個の記録ヘッドとして の構成のいずれでもよい。

【0014】加えて、装置本体に装着されることで、装 置本体との電気的な接続や装置本体からのインクの供給 が可能になる交換自在のチップタイプの記録ヘッド、あ るいは記録ヘッド自体に一体的に設けられたカートリッ ジタイプの記録ヘッドを用いた場合にも本発明は有効で

【0015】また、本発明の記録装置の構成として設け られる、記録ヘッドに対しての回復手段、予備的な補助 手段などを付加することは本発明の効果を一層安定化で きるので好ましいものである。これらを具体的に挙げれ ば、記録ヘッドに対しての、キャッピング手段、クリー ニング手段、加圧あるいは吸引手段、電気熱変換体ある ンデマンド型、コンティニュアス型のいずれにも適用可 40 いはこれとは別の加熱素子あるいはこれらの組み合わせ による予備加熱手段、配録とは別の吐出を行なう予備吐 出モードを行なうことも安定した記録を行なうために有 効である。

> 【0016】さらに、配像装置の記録モードとしては黒 色等の主流色のみの記録モードだけではなく、記録ヘッ ドを一体的に構成するか複数個の組み合わせによってで もよいが、異なる色の複色カラーまたは、混色によるフ ルカラーの少なくとも一つを備えた装置にも本発明は極 めて有効である。

5

て説明しているが、室温やそれ以下で固化するインクで あって、室温で軟化もしくは液体あるいは、上述のイン クジェットではインク自体を30℃以上70℃以下の範 囲内で温度調整を行なってインクの粘性を安定吐出範囲 にあるように温度制御するものが一般的であるから、使 用記録信号付与時にインクが液状をなすものであればよ い。加えて、積極的に熱エネルギーによる昇温をインク の固形状態から液体状態への態変化のエネルギーとして 使用せしめることで防止するかまたは、インクの蒸発防 止を目的として放置状態で固化するインクを用いるかし 10 て、いずれにしても熱エネルギーの記録信号に応じた付 与によってインクが液化してインク液状として吐出する ものや記録媒体に到達する時点ではすでに固化し始める ものなどのような、熱エネルギーによって初めて液化す る性質のインク使用も本発明には適用可能である。この ような場合インクは、特開昭54-56847号公報あ るいは特開昭60-71260号公報に記載されるよう な、多孔質シート凹部または貫通孔に液状または固形物 として保持された状態で、電気熱変換体に対して対向す るような形態としてもよい。本発明においては、上述し 20 た各インクに対して最も有効なものは、上述した膜沸騰 方式を実行するものである。

【0018】図3は上記処理のための機構を備えたインクジェット記録装置の一例を示す外観斜視図である。

【0019】図において、501はプラテン507上に 送紙されてきた記録紙の記録面に対向してインク吐出を 行うノズル群を備えたインクジェットヘッドカートリッジ (IJC) である。502はIJC501を保持する キャリッジ (HC) であり、駆動モーター503の駆動 力を伝達する駆動ベルト504の一部と連結し、互いに 30平行に配設された2本のガイドシャフト505及び506と摺動可能とすることにより、IJC501の記録紙の全幅にわたる往復移動が可能となる。

【0020】508はヘッド回復装置であり、IJC501の移動経路の一端、例えばホームポジションと対向する位置に配設される。伝動機構509を介したモーター510の駆動力によって、ヘッド回復装置508を動作せしめ、IJC501のキャッピングを行う。このヘッド回復装置508のキャップ部511によるIJC501へのキャッピングに関連させて、ヘッド回復装置5408内に設けた適宜の吸引手段によるインク吸引もしくはIJC501へのインク供給経路に設けた適宜の加圧手段によるインク圧送を行い、インクを吐出口より強制的に排出させることによりノズル内の増粘インクを除去する等の吐出回復処理を行う。また、配録終了時等にキャッピングを施すことにより記録ヘッドが保護される。

【0021】512はヘッド回復装置508の側面に配 訳される本発明のクリーニングブレードである。ブレード512はブレード保持部材513にカンチレバー形態 で保持され、ヘッド回復装置508と同様。チーター5 10及び伝動機構509によって作動し、1JC501 の吐出面との係合が可能となる。これにより、IJC5 01の記録動作における適切なタイミングで、あるいは ヘッド回復装置508を用いた吐出回復処理後に、プレ ード512をIJC501の移動経路中に突出させ、1 JC501の移動動作に伴ってIJC501の吐出面に おける結構、濡れあるいは塵埃等を拭き取るものであ

[0022]

(2) 【実施例】以下、実施例により本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらの実施例により限定されるものではない。

【0023】実施例1

図1は本発明を説明するためのものである。以下図面を 参照して説明する。

【0025】次に、同一のマスクを用いこのレジストパターン7上にアラインメントを行って再度800mJ/cm²の露光量でパターン露光した後(図1-d)、0.75wt.%の水酸化ナトリウム水溶液を用いて現像し、ついでイオン交換水でリンス処理を施し、真空オーブン中で70℃、30分間のポストペークを行ってレジストパターン8を得た(図1-e)。

【0026】このようにして得られたレジストパターンの断面形状を光学顕微鏡により観察したところ、レジスト成部まで現像された矩形のレジストパターンであることが確認された。

40 【0027】次にこのレジストパターン上に800ml/cm²の露光量で全面露光を行い、0.1mmlgの真空条件下で30分間の脱気処理を行った後、レジストパターン上に、日木ユニオンカーパイト社製エポキシ樹脂、

Cyracure UVR-6110 40重量部 Cyracure UVR-6200 20重量部 Cyracure UVR-6351 40重量部 及び

トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネート 1 **1 重量部**

で保持され、ヘッド回復装置508と同様、モーター5 50 からなる光硬化型の液流路形成用材料を被覆し、8.5

J/cm²の電光量で全面電光を行って液流路形成用材料を 硬化させた。次いで被処理基板を3.0vi.%の水酸化 ナトリウム水溶液中に浸漬し、レジストパターンを溶解 除去した。

【0028】このようにして作製されたノズルは精度が 非常に高く、また信頼性の高いものが得られた。更に、 このように作製された液体噴射記録ヘッドは安定な印字 が可能であった。

【0029】実施例2

液体吐出エネルギー発生素子としての電気熱変換体を形 10 成したガラス被処理基板上にポジ型フォトレジストPM ER-PG7900 (東京応化社製) を膜厚40μmと なるようにスピンコートし、オープン中で90℃、40 分間のプリベークを行ってレジスト層を形成した。この レジスト層上にノズルパターンのマスクを介してマスク アライナーPLA-501 (キヤノン製) により、90 OnJ/cm²の露光量でパターン露光した後、1.25wt. %の水酸化ナトリウム水溶液を用いて現像し、ついでイ オン交換水でリンス処理を施し、真空オープン中で50 \mathbb{C} 、30分間のポストペークを行い、20 μ mまで現像 20 されたレジストパターンを得た。

【0030】次に、同一のマスクを用いこのレジストパ ターン上にアラインメントを行って再度900mJ/cm2の 露光量でパターン露光した後、1.25 Wt.%の水酸化 ナトリウム水溶液を用いて現像し、ついでイオン交換水 でリンス処理を施し、真空オープン中で70℃、30分 間のポストペークを行ってレジストバターンを得た。

【0031】このようにして得られたレジストパターン の断面形状を光学顕微鏡により観察したところ、レジス ト底部まで現像された矩形のレジストパターンであるこ 30 とが確認された。

【0032】次にこのレジストパターン上に1.01/cm ²の露光量で全面露光を行い、0.1mmHgの真空条件下 で30分間の脱気処理を行った後、レジストバターン上 に、日本ユニオンカーパイト社製工ポキシ樹脂、

Cyracure UVR-6110 40重量部 Cyracure UVR-6200 20重量部 Cyracure UVR-6351 40重量部 及び

トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネー 40 ーニングされた部分も極端な台形形状であった。 ト 1 重量部

からなる光硬化型の液流路形成用材料を被覆し、8.5 J/cm² の露光量で全面露光を行って液流路形成用材料を 硬化させた。次いで被処理基板を3.0♥1.%の水酸化 ナトリウム水溶液中に浸漬し、レジストパターンを溶解

【0033】このようにして作製されたノズルは精度が 非常に高く、また信頼性の高いものが得られた。更に、 このように作製された液体噴射記録ヘッドは安定な印字 が可能であった。

【0034】実施例3

実施例1で得られたレジストパターン上に、住友ペーク ライト社製エポキシ樹脂EME-700からなる熱硬化 型の液流路形成用材料をトランスファーモールド法によ り被覆し、150℃、10時間のペークを行って液流路 形成用材料を硬化させた。次いで被処理基板を3.0w t. %の水酸化ナトリウム水溶液中に浸漬し、レジストパ ターンを溶解除去した。

8

【0035】このようにして作製されたノズルは精度が 非常に高く、また信頼性の高いものが得られた。更に、 このように作製された液体噴射記録ヘッドは安定な印字 が可能であった。

[0036] 実施例4

実施例2で得られたレジストパターン上に、住友ペーク ライト社製エポキシ樹脂EME-700からなる熱硬化 型の液流路形成用材料をトランスファーモールド法によ り被覆し、150℃、10時間のペークを行って被流路 形成用材料を硬化させた。次いで被処理基板を3.0% 1. %の水酸化ナトリウム水溶液中に浸漬し、レジストバ ターンを溶解除去した。

【0037】このようにして作製されたノズルは精度が 非常に高く、また信頼性の高いものが得られた。更に、 このように作製された液体噴射記録ヘッドは安定な印字 が可能であった。

【0038】比較例1

液体吐出エネルギー発生素子としての電気熱変換体を形 成したガラス被処理基板上にポジ型フォトレジストAZ - 4903 (ヘキスト社製) を膜厚40μmとなるよう にスピンコートし、オープン中で90℃、40分のプリ ペークを行ってレジスト層を形成した。このレジスト層 上にノズルパターンのマスクを介してマスクアライナー PLA-501 (キヤノン製) により、2J/cm²の露光 量でパターン露光した後、0、75 wt. %の水酸化ナト リウム水溶液を用いて現像し、ついでイオン交換水でリ ンス処理を施し、真空オープン中で70℃、30分間の ポストペークを行ってレジストパターンを得た。

【0039】このようにして得られたレジストパターン の断面形状を光学顕微鏡により観察したところ、基板か ら10μmのレジストが現像されずに残っており、パタ

【0040】比較例2

液体叶出エネルギー発生素子としての質気熱変換体を形 成したガラス被処理基板上にポジ型フォトレジストPM ER-PG7900 (東京応化社製)を膜厚40μmと なるようにスピンコートし、オープン中で90℃、40 分のプリベークを行ってレジスト層を形成した。このレ ジスト層上にノズルパターンのマスクを介してマスクア ライナーPLA-501 (キヤノン製) により、2J/cm ¹の露光量でパターン露光した後、1.25 wt. %の水酸 50 化ナトリウム水溶液を用いて現像し、ついでイオン交換

水でリンス処理を施し、真空オープン中で70℃、30 分間のポストペークを行ってレジストパターンを得た。

【0041】このようにして得られたレジストパターン の断面形状を光学顕微鏡により観察したところ、基板か ら 15μ mのレジストが現像されずに残っており、パタ ーニングされた部分も極端な台形形状であった。

[0042]

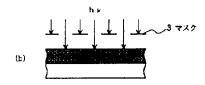
【発明の効果】以上説明したように、本発明による液体 噴射記録ヘッドの製造方法を採用することにより、信頼 性の高い微細ノズルを有する液体噴射記録ヘッドを製造 10 4、7、8 レジストパターン することができる.

【図面の簡単な説明】

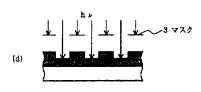
【図1】本発明によるレジストパターンの形成の工程を

[図1]











説明するための概略断面図である。

【図2】従来法による液体噴射配録ヘッドの製造工程を 説明するための優略断面図である。

10

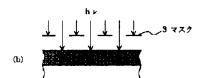
【図3】本発明の液体噴射記録ヘッドを搭載したインク ジェット記録装置の一例を示す外観斜視図である。

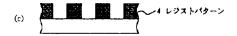
【符号の説明】

- 1 被処理基板
- 2 ポジ型フォトレジスト
- 3 マスク
- - 5 液流路形成用材料
 - 6 液流路

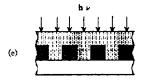
【図2】

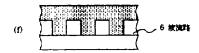




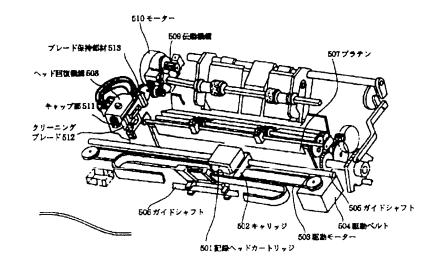








【図3】



フロントページの続き

 (51) Int. Cl.⁵
 識別記号
 庁内整理番号
 F I
 技術表示箇所

 9012-2C
 B 4 1 J
 3/04
 1 0 3
 H

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-8437

(43)公開日 平成6年(1994)1月18日

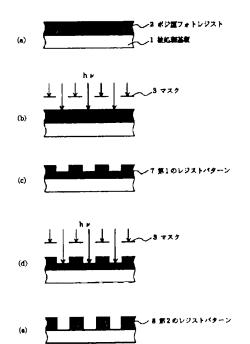
	2/21	識別記号	庁内整理番号	F l		技術表示箇序
	2/16		9012-2C 8306-2C		3/04 1 0 3 B	
					101 A 請求項の数12(全 7 頁)	最終頁に続く
21)出顧番号		特顧平4-1 66400		(71)出願人	000001007	
					キヤノン株式会社	
(22) 出 順日		平成4年(1992)6月24日			東京都大田区下丸子3丁目3	0番2号
				(72)発明者		
					東京都大田区下丸子3丁目3 ノン株式会社内	0番2号 キヤ
				(72)発明者		
				(12/30914	東京都大田区下丸子3丁目3	0番2号 キヤ
					ノン株式会社内	
				(74)代理人	弁理士 若林 忠	

(54) 【発明の名称】 液体噴射記録ヘッド、その製造方法及び記録装置

(57)【要約】

【構成】 被処理基板1上にポジ型フォトレジスト層2 を形成後、マスク3を介して露光し、現像してレジスト のパターニングを行なう際に、露光、現像処理を2度以 上施してパターン形成を行なう。

【効果】 信頼性の高いノズルを有する液体噴射記録へ ッドを製造することができる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 液体吐出エネルギー発生部を有する被処 理基板上にポジ型フォトレジストからなる感光層を形成 し、所要の露光、現像処理を行ってポジ型フォトレジス トをパターニングした後、レジストパターン上に液流路 形成用材料を被覆し、液流路形成用材料を硬化させた 後、パターニング処理されたポジ型フォトレジストを溶 解除去することによって液流路が形成された構造を有す る液体噴射記録ヘッドにおいて、ポジ型フォトレジスト のパターニング時に、露光、現像処理を二度以上施して 10 上記工程を行うことを特徴とする液体噴射記録ヘッド。

【請求項2】 液流路形成用材料が活性エネルギー線硬 化型材料であることを特徴とする請求項1に記載の液体 噴射記録ヘッド。

【蕭求項3】 液流路形成用材料が熱硬化型材料である ことを特徴とする請求項1に記載の液体噴射記録ヘッ

【請求項4】 液体吐出エネルギー発生部が、熱エネル ギーを発生する電気熱変換体であることを特徴とする請 求項1に記載の液体噴射記録ヘッド。

【請求項5】 記録媒体の記録領域の全幅にわたって吐 出口が複数設けられているフルラインタイプのものであ ることを特徴とする請求項1に記載の液体噴射記録ヘッ

【請求項6】 多色用の吐出口が一体成形されたもので あることを特徴とする請求項1に記載の液体噴射記録へ

【請求項7】 液体吐出エネルギー発生部を有する被処 理基板上にポジ型フォトレジストからなる感光層を形成 し、所要の露光、現像処理を行ってポジ型フォトレジス 30 程(e))。更に、上記パターニングされた固体層を、 トをパターニングした後、レジストパターン上に被流路 形成用材料を被覆し、液流路形成用材料を硬化させた 後、パターニング処理されたポジ型フォトレジストを溶 解除去することによって液流路を形成する液体噴射記録 ヘッドの製造方法において、ポジ型フォトレジストのパ ターニング時に、露光、現像処理を二度以上施して上記 工程を行うことを特徴とする液体噴射配録ヘッドの製造 方法。

【請求項8】 ポジ型フォトレジストの現像液としてア ルカリ水溶液を用いることを特徴とする請求項7に記載 40 ーニングの際に用いられる I 線や g 線といった露光波長 の製造方法。

【請求項9】 ポジ型フォトレジストがナフトキノンジ アジド誘導体を含有するものであることを特徴とする請 求項7に記載の製造方法。

【請求項10】 ポジ型フォトレジストが化学増幅型の ものであることを特徴とする請求項7に記載の製造方 法。

【請求項11】 記録媒体の被記録面に対向してインク を吐出するインク吐出口が設けられている請求項1に記 載の液体噴射記録ヘッドと、該ヘッドを載置するための 50 【0006】

2 部材とを少なくとも具備することを特徴とするインクジ エット記録装置。

【請求項12】 請求項11に記載のインクジェット記 録装置において、カラー記録を行うことを特徴とするイ ンクジェット記録装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はインクジェット記録方式 に用いる記録液小滴を発生させるための液体噴射記録へ ッド、その製造方法及び該記録ヘッドを用いた記録装置 に関する。

[0002]

【従来の技術】インクジェット記録方式(液体噴射記録 方式)に適用される液体噴射記録ヘッドは、一般に微細 な記録液吐出口(オリフィス)、液体流路及び液体流路 の一部に設けられる液体吐出エネルギー発生部を備えて いる。従来このような液体噴射記録ヘッドを作製する方 法としては、例えば、特開昭61-154947号公 報、同62-253457号公報に記載された次のよう 20 な工程による方法が知られている。

【0003】図2に示すように、先ず、被処理基板1上 に感光性樹脂層(ポジ型フォトレジスト2)を形成し (工程(a))、これをマスク3を介して露光(工程 (h))、現像処理を施して感光性樹脂層をパターニン グレ、被処理基板上に固体層を形成する(工程 (c))。次に、パターニングされた固体層上に活性エ ネルギー線硬化型あるいは熱硬化型の液流路形成用材料 5 を被覆し(T.程(d))、活性エネルギー線照射ある いは加熱により上記液流路形成用材料を硬化させる(エ 含ハロゲン炭化水素、ケトン、エステル、エーテル、ア ルコール等の有機溶剤あるいは水酸化ナトリウム、水酸 化カリウム等のアルカリ水溶液を用いて溶解除去し、液 流路6を形成する(工程(f))。

【0004】上記の工程において、固体層を形成するた めの感光性樹脂材料としては、一般にナフトキノンジア ジド誘導体を含有するポジ型フォトレジストが用いられ ている。ここで用いられるポジ型フォトレジスト中に含 まれるナフトキノンジアジド誘導体は、レジストのパタ に対して強い吸収を有している。このため、レジストを 厚膜で使用する場合には、照射された光がレジスト膜中 で減衰し、レジストの下層部において露光量が不足し十 分なパターニングが不可能となる。

【0005】現在、厚膜用として市販されているレジス トを用いた場合においても、寸法精度良くパターニング できる膜厚はせいぜい 2 0 μ m程度であり、それ以上の 膜厚においては上部が極端な台形のレジストパターンし か得られていない。

【発明が解決しようとする課題】本願発明における目的 は、除去可能な固体層としてポジ型フォトレジストを用 いた場合に、寸法精度良くパターニングされたレジスト パターンを形成し、信頼性の高い液体噴射記録ヘッドを 提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】本発明者らは上記課題を 解決するために鋭意検討した結果、本発明に到達したも のである。

【0008】本願発明は、液体吐出エネルギー発生部を 10 有する被処理基板上にポジ型フォトレジストからなる感 光層を形成し、所要の露光、現像処理を行ってポジ型フ オトレジストをパターニングした後、レジストパターン 上に液流路形成用材料を被覆し、液流路形成用材料を硬 化させた後、バターニング処理されたポジ型フォトレジ ストを溶解除去することによって液流路が形成された構 造を有する液体噴射記録ヘッドにおいて、ポジ型フォト レジストのパターニング時に、露光、現像処理を二度以 上施して上記工程を行うことを特徴とする液体噴射記録 ヘッドの製造方法であり、該方法により提供される液体 20 噴射記録ヘッドである。

【0009】このように、ポジ型フォトレジストのパタ ーニングに際して、レジストのパターニング時の電光、 現像処理を2度以上に分けて行うことによって、厚膜に おいても寸法精度の優れた整った矩形のレジストパター ンを形成することができ、吐出特性の優れた信頼性の高 い液体噴射記録ヘッドを提供できる。また、上記方法に おいては、ナフトキノン系のポジ型フォトレジストを用 いた場合の液体噴射記録ヘッドの製造方法を示している 場合においても適用可能である。

【0010】本発明は、特にインクジェット記録方式の 中でも、熱エネルギーを利用してインクを吐出させる方 式の記録ヘッド、記録装置において、優れた効果をもた らすものである。

【0011】その代表的な構成や原理については、例え ば、米国特許第4,723,129号明細書、同第4, 740、796号明細書に開示されている基本的な原理 を用いて行なうものが好ましい。この方式はいわゆるオ 能であるが、特に、オンデマンド型の場合には、液体 (インク) が保持されているシートや被路に対応して配 置されている電気熱変換休に、記録情報に対応していて 核沸騰を越える急速な温度上昇を与える少なくとも一つ の駆動信号を印加することによって、電気熱変換体に熱 エネルギーを発生せしめ、記録ヘッドの熱作用面に膜沸 騰させて、結果的にこの駆動信号に一対一対応し液体 (インク)内の気急を形成出来るので有効である。この 気泡の成長、収縮により吐出用開口を介して液体(イン ク)を吐出させて、少なくとも一つの滴を形成する。こ 50 【0017】以上の説明においては、インクを液体とし

の駆動信号をパルス形状とすると、即時適切に気泡の成 長収縮が行なわれるので、特に応答性に優れた液体(イ ンク)の吐出が達成でき、より好ましい。このパルス形 状の駆動信号としては、米国特許第4、463、359 号明細書、同第4,345,262号明細書に記載され ているようなものが適している。なお、上記熱作用面の 温度上昇率に関する発明の米国特許第4、313、12 4号明細書に記載されている条件を採用すると、さらに 優れた記録を行なうことができる。

【0012】記録ヘッドの構成としては、上述の各明細 書に開示されているような吐出口、液路、電気熱変換体 の組み合わせ構成(直線状液流路または直角液流路)の 他に熱作用部が屈曲する領域に配置されている構成を関 示する米国特許第4,558,333号明細書、米国特 許第4,459,600号明細書を用いた構成も本発明 に含まれるものである。加えて、複数の電気熱変換体に 対して、共通するスリットを電気熱変換体の吐出部とす る構成を開示する特開昭59-123670号公報や熱 エネルギーの圧力波を吸収する関口を吐出部に対応させ る構成を開示する特開昭59-138461号公報に基 づいた構成としても本発明は有効である。

【0013】さらに、記録装置が記録できる最大記録媒 体の幅に対応した長さを有するフルラインタイプの記録 ヘッドとしては、上述した明細書に開示されているよう な複数記録ヘッドの組み合わせによって、その長さを満 たす構成や一体的に形成された一個の記録ヘッドとして の構成のいずれでもよい。

【0014】加えて、装置本体に装着されることで、装 置本体との電気的な接続や装置本体からのインクの供給 が、これは化学増幅型のボジ型フォトレジストを用いた。30 が可能になる交換自在のチップタイプの記録ヘッド、あ るいは記録ヘッド自体に一体的に設けられたカートリッ ジタイプの記録ヘッドを用いた場合にも本発明は有効で ある。

【0015】また、本発明の記録装置の構成として設け られる、記録ヘッドに対しての回復手段、予備的な補助 手段などを付加することは本発明の効果を一層安定化で きるので好ましいものである。これらを具体的に挙げれ ば、記録ヘッドに対しての、キャッピング手段、クリー ニング手段、加圧あるいは吸引手段、電気熱変換体ある ンデマンド型、コンティニュアス型のいずれにも適用可 40 いはこれとは別の加熱素子あるいはこれらの組み合わせ による予備加熱手段、配録とは別の吐出を行なう予備吐 出モードを行なうことも安定した記録を行なうために有 効である。

> 【0016】さらに、配録装置の記録モードとしては黒 色等の主流色のみの記録モードだけではなく、記録ヘッ ドを一体的に構成するか複数個の組み合わせによってで もよいが、異なる色の複色カラーまたは、混色によるフ ルカラーの少なくとも一つを備えた装置にも本発明は極 めて有効である。

て説明しているが、室温やそれ以下で固化するインクで あって、室温で軟化もしくは液体あるいは、上述のイン クジェットではインク自体を30℃以上70℃以下の範 囲内で温度調整を行なってインクの粘性を安定吐出範囲 にあるように温度制御するものが一般的であるから、使 用記録信号付与時にインクが液状をなすものであればよ い。加えて、積極的に熱エネルギーによる昇温をインク の固形状態から液体状態への態変化のエネルギーとして 使用せしめることで防止するかまたは、インクの蒸発防 止を目的として放置状態で固化するインクを用いるかし 10 て、いずれにしても熱エネルギーの記録信号に応じた付 与によってインクが液化してインク液状として吐出する ものや記録媒体に到達する時点ではすでに固化し始める ものなどのような、熱エネルギーによって初めて液化す る性質のインク使用も本発明には適用可能である。この ような場合インクは、特開昭54-56847号公報あ るいは特開昭60-71260号公報に記載されるよう な、多孔質シート凹部または貫通孔に液状または固形物 として保持された状態で、電気熱変換体に対して対向す るような形態としてもよい。本発明においては、上述し 20 た各インクに対して最も有効なものは、上述した膜沸騰 方式を実行するものである。

【0018】図3は上記処理のための機構を備えたイン クジェット記録装置の一例を示す外観斜視図である。

【0019】図において、501はプラテン507上に 送紙されてきた記録紙の記録面に対向してインク吐出を 行うノズル群を備えたインクジェットヘッドカートリッ ジ(1 JC) である。502は1 JC501を保持する キャリッジ (HC) であり、駆動モーター503の駆動 力を伝達する駆動ベルト504の一部と連結し、互いに 30 平行に配設された2本のガイドシャフト505及び50 6と摺動可能とすることにより、110501の記録紙 の全幅にわたる往復移動が可能となる。

【0020】508はヘッド回復装置であり、IJC5 01の移動経路の一端、例えばホームポジションと対向 する位置に配設される。伝動機構509を介したモータ -510の駆動力によって、ヘッド回復装置508を動 作せしめ、IJC501のキャッピングを行う。このへ ッド回復装置508のキャップ部511によるIJC5 01へのキャッピングに関連させて、ヘッド回復装置5 40 0.8内に設けた適宜の吸引手段によるインク吸引もしく はIJC501へのインク供給経路に設けた適宜の加圧 手段によるインク圧送を行い、インクを吐出口より強制 的に排出させることによりノズル内の増粘インクを除去 する等の吐出回復処理を行う。また、記録終了時等にキ ャッピングを施すことにより記録ヘッドが保護される。

【0021】512はヘッド回復装置508の側面に配 散される本発明のクリーニングプレードである。プレー ド512はプレード保持部材513にカンチレパー形態 で保持され、ヘッド回復装置508と同様、モーター5 50 からなる光硬化型の液流路形成用材料を被覆し、8.5

10及び伝動機構509によって作動し、IJC501 の吐出面との係合が可能となる。これにより、IJC5 01の記録動作における適切なタイミングで、あるいは ヘッド回復装置508を用いた吐出回復処理後に、プレ ード512をIJC501の移動経路中に突出させ、1 JC501の移動動作に伴ってIJC501の吐出面に おける結構、濡れあるいは塵埃等を拭き取るものであ

[0022]

【実施例】以下、実施例により本発明を更に詳細に説明 するが、本発明はこれらの実施例により限定されるもの ではかい。

【0023】実施例1

図1は本発明を説明するためのものである。以下図面を 参照して説明する。

【0024】先ず、液体吐出エネルギー発生素子として の電気熱変換体を形成したガラス被処理基板 1 上にポジ 型フォトレジストAZ-4903(ヘキスト社製)を膜 厚40μmとなるようにスピンコートし、オープン中で 90℃、40分のプリペークを行ってレジスト層2を形 成した(図1-a)。このレジスト層2上にノズルパタ ーンのマスク3を介してマスクアライナーPLA-50 1 (キヤノン製) により、800mJ/cm²の露光量でパタ ーン露光した後 (図1-b)、0.75 wt.%の水酸化 ナトリウム水溶液を用いて現像し、ついでイオン交換水 でリンス処理を施し、真空オープン中で50℃、30分 間のポストペークを行い、 20μ mまで現像されたレジ ストパターン7を得た(図1-c)。

【0025】次に、同一のマスクを用いこのレジストバ ターン7上にアラインメントを行って再度800mJ/cm² の露光量でパターン露光した後(図1-d)、0.75 ₩t. %の水酸化ナトリウム水溶液を用いて現像し、つい でイオン交換水でリンス処理を施し、真空オープン中で 70℃、30分間のポストペークを行ってレジストパタ ーン8を得た(図1-e)。

【0026】このようにして得られたレジストパターン の断面形状を光学顕微鏡により観察したところ、レジス ト底部まで現像された矩形のレジストパターンであるこ とが確認された。

【0027】次にこのレジストパターン上に800町/c n²の露光量で全面露光を行い、0.1 mmEgの真空条件下 で30分間の脱気処理を行った後、レジストパターン上 に、日木ユニオンカーパイト社製エポキシ樹脂、

Cyracure UVR-6110 40重量部 Cyracure UVR-6200 20重量部 Cyracure UVR-6351 40重量部 及び

トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネー ト 1 重量部

J/cm² の属光量で全面属光を行って液流路形成用材料を 硬化させた。次いで被処理基板を3.0♥1.%の水酸化 ナトリウム水溶液中に浸漬し、レジストパターンを溶解 除去した。

【0028】このようにして作製されたノズルは精度が 非常に高く、また信頼性の高いものが得られた。更に、 このように作製された液体噴射記録ヘッドは安定な印字 が可能であった。

【0029】実施例2

液体吐出エネルギー発生素子としての電気熱変換体を形 10 成したガラス被処理基板上にポジ型フォトレジストPM ER-PG7900 (東京応化社製) を膜厚40μmと なるようにスピンコートし、オープン中で90℃、40 分間のプリベークを行ってレジスト層を形成した。この レジスト層上にノズルパターンのマスクを介してマスク アライナーPLA-501 (キヤノン製) により、90 OnJ/cm² の露光量でパターン露光した後、1、25 wt. %の水酸化ナトリウム水溶液を用いて現像し、ついでイ オン交換水でリンス処理を施し、真空オープン中で50 \mathbb{C} 、30分間のポストペークを行い、20 μ mまで現像 20 ターンを溶解除去した。 されたレジストバターンを得た。

【0030】次に、同一のマスクを用いこのレジストパ ターン上にアラインメントを行って再度900mJ/cm²の 露光量でパターン露光した後、1.25 wt.%の水酸化 ナトリウム水溶液を用いて現像し、ついでイオン交換水 でリンス処理を施し、真空オープン中で70℃、30分 間のポストペークを行ってレジストバターンを得た。

【0031】このようにして得られたレジストパターン の断面形状を光学顕微鏡により観察したところ、レジス とが確認された。

【0032】次にこのレジストパターン上に1.0J/cm ²の露光量で全面露光を行い、0.1mm版の真空条件下 で30分間の脱気処理を行った後、レジストパターン上 に、日本ユニオンカーパイト社製エポキシ樹脂、

Cyracure UVR-6110 40重量部 Cyracure UVR-6200 20重量部 Cyracure UVR-6351 40電量部

トリフェニルスルホニウムヘキサフルオロアンチモネー 40 ーニングされた部分も極端な台形形状であった。 ト 1重量部

からなる光硬化型の液流路形成用材料を被覆し、8.5 J/cm² の露光量で全面電光を行って液流路形成用材料を 硬化させた。次いで被処理基板を3.0 wt.%の水酸化 ナトリウム水溶液中に浸漬し、レジストパターンを溶解

【0033】このようにして作製されたノズルは精度が 非常に高く、また信頼性の高いものが得られた。更に、 このように作製された液体噴射記録ヘッドは安定な印字 が可能であった。

【0034】実施例3

実施例1で得られたレジストパターン上に、住友ペーク ライト社製エポキシ樹脂EME-700からなる熱硬化 型の液流路形成用材料をトランスファーモールド法によ り被覆し、150℃、10時間のペークを行って被流路 形成用材料を硬化させた。次いで被処理基板を3.0w t.%の水酸化ナトリウム水溶液中に浸漬し、レジストパ ターンを溶解除去した。

【0035】このようにして作製されたノズルは精度が 非常に高く、また信頼性の高いものが得られた。更に、 このように作製された液体噴射記録ヘッドは安定な印字 が可能であった。

[0036] 実施例4

実施例2で得られたレジストパターン上に、住友ペーク ライト社製エポキシ樹脂EME-700からなる熱硬化 型の液流路形成用材料をトランスファーモールド法によ り被覆し、150℃、10時間のペークを行って被流路 形成用材料を硬化させた。次いで被処理基板を3.0% t.%の水酸化ナトリウム水溶液中に浸漬し、レジストバ

【0037】このようにして作製されたノズルは精度が 非常に高く、また信頼性の高いものが得られた。更に、 このように作製された液体噴射記録ヘッドは安定な印字 が可能であった。

【0038】比較例1

液体吐出エネルギー発生素子としての電気熱変換体を形 成したガラス被処理基板上にポジ型フォトレジストA2 - 4903 (ヘキスト社製) を膜厚40 μmとなるよう にスピンコートし、オープン中で90℃、40分のプリ ト底部まで現像された矩形のレジストパターンであるこ 30 ペークを行ってレジスト層を形成した。このレジスト層 上にノズルバターンのマスクを介してマスクアライナー PLA-501 (キヤノン製) により、2J/cm2の露光 量でパターン露光した後、0.75 wt.%の水酸化ナト リウム水溶液を用いて現像し、ついでイオン交換水でリ ンス処理を施し、真空オープン中で70℃、30分間の ポストペークを行ってレジストパターンを得た。

> 【0039】このようにして得られたレジストパターン の断面形状を光学顕微鏡により観察したところ、基板か ら10μmのレジストが現像されずに残っており、パタ

【0040】比較例2

液体吐出エネルギー発生素子としての電気熱変換体を形 成したガラス被処理基板上にポジ型フォトレジストPM ER-PG7900 (東京応化社製) を膜厚40μmと なるようにスピンコートし、オープン中で90℃、40 分のプリペークを行ってレジスト層を形成した。このレ ジスト層上にノズルバターンのマスクを介してマスクア ライナーPLA-501 (キヤノン製) により、21 cg 3の露光量でパターン露光した後、1.25 wt. %の水酸 50 化ナトリウム水溶液を用いて現像し、ついでイオン交換

水でリンス処理を施し、真空オープン中で70℃、30 分間のポストペークを行ってレジストパターンを得た。

【0041】このようにして得られたレジストパターン の断面形状を光学顕微鏡により観察したところ、基板か ら15μmのレジストが現像されずに残っており、パタ ーニングされた部分も極端な台形形状であった。

[0042]

【発明の効果】以上説明したように、本発明による液体 噴射記録ヘッドの製造方法を採用することにより、信頼 性の高い微細ノズルを有する液体噴射記録ヘッドを製造 10 4、7、8 レジストパターン することができる.

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明によるレジストパターンの形成の工程を

ジェット記録装置の一例を示す外観斜視図である。 【符号の説明】

- 1 被処理基板
- 2 ポジ型フォトレジスト

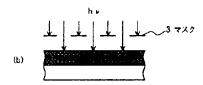
説明するための概略断面図である。

説明するための概略断面図である。

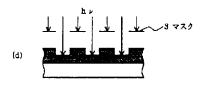
- 3 マスク
- - 5 液流路形成用材料
 - 6 液流路

[図1]











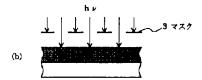
[図2]

10

【図2】従来法による液体噴射記録ヘッドの製造工程を

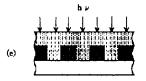
【図3】本発明の液体噴射記録ヘッドを搭載したインク

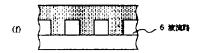




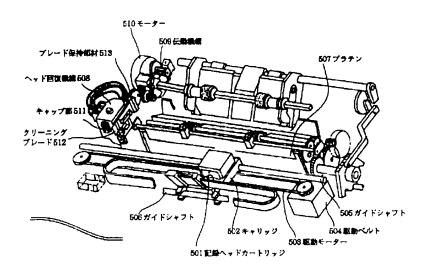








【図3】



フロントページの続き

 (51) Int. Cl.5
 識別記号
 庁内整理番号
 F I
 も

 9012-2C
 B 4 1 J
 3/04
 1 0 3 H

技術表示箇所

		• .